УДК 669.046:533.9:539.4.015.2

## СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ СПЛАВОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ПЛЕНКА/ПОДЛОЖКА ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА<sup>\*</sup>

Иванов Ю.Ф.<sup>1,2</sup>, д.ф.-м.н., доцент (уиfi55@mail.ru) Крысина О.В.<sup>1</sup>, младший научный сотрудник Петрикова Е.А.<sup>1</sup>, аспирант Тересов А.Д.<sup>1</sup>, ведущий электроник Клопотов А.А.<sup>3</sup>, д.ф.-м.н., профессор

 <sup>1</sup> Институт сильноточной электроники СО РАН (634055, Россия, г. Томск, Академический пр., 2/3)
<sup>2</sup> Национальный исследовательский Томский политехнический университет (634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30)
<sup>3</sup> Томский государственный архитектурно-строительный университет (634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2)

Аннотация. Синтезированы, методом импульсного плавления системы пленка/подложка высокоинтенсивным электронным пучком, наноструктурированные многофазные поверхностные легкие сплавы системы Al–Ti–Cu. Выявлены режимы облучения, позволяющие многократно повысить прочностные и трибологические характеристики исходного материала.

Ключевые слова: пленка/подложка, электронный пучок, поверхностные сплавы, фазовый состав, структура, свойства.

Как правило, облучение поверхности металлов и сплавов интенсивными импульсными электронными пучками приводит к формированию неравновесных структурнофазовых состояний, содержащих наноструктурную составляющую. Физическая основа такого процесса заключается в реализации условий сверхвысоких скоростей нагрева (до 10<sup>9</sup> К/с) поверхностного слоя до закритических температур (расплав, испарение) и формировании предельных градиентов температуры (10<sup>7</sup> – 10<sup>8</sup> К/м), обеспечивающих охлаждение поверхностного слоя за счет теплоотвода в основной объем материала со скоростями (10<sup>4</sup> – 10<sup>6</sup>) К/с [1]. Цель работы – выявление физических закономерностей синтеза поверхностных сплавов в системе пленка/подложка, подвергнутой обработке высокоинтенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности.

Синтез пленок состава Ті – Си толщиной 0,5 и 1,0 мкм осуществляли вакуумно-дуговым методом с плазменным ассистированием на подложки из технически чистого алюминия А7 путем испарения катодов из спеченного материала Ті – 12 % Си. При синтезе покрытий использовали дуговой испаритель ДИ100 с усиленным охлаждением рабочего катода, что позволило снизить долю капельной фракции в покрытии и уменьшить размер микрочастиц. Непосредственно перед напылением образцы подвергались бомбардировке ионами аргона, в

<sup>\*</sup> Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (проекты № 13-08-00416 и № 13-08-98084). ходе которой поверхностный слой очищался от адсорбированных газов и диэлектрических включений.

Параметры процесса очистки подбирались таким образом, чтобы не происходило значительного нагрева и травления поверхности образцов: плотность ионного тока на подложку была не больше 1,5 мА/см<sup>2</sup>, температура во время ионной бомбардировки не превышала примерно 348 К. Оптимизацию режимов осаждения проводили так, чтобы скорость роста покрытий была высокой, но при этом максимальные размеры микрочастиц, присутствующих в плазменном потоке, не превышали в диаметре толщину покрытий. Соответственно этому синтез пленки Ті-Си осуществляли при следующих основных параметрах: давление аргона 0,2 Па, ток дугового разряда 60 А, скорость роста покрытий 1,5 мкм/ч. Во время осаждения образцы находились под плавающим потенциалом (-15 В). Температура образцов в течение осаждения покрытий не превышала 393 К.

Плавление системы пленка/подложка осуществляли высокоинтенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности воздействия на установке «СОЛО» [2]. Параметры пучка электронов: энергия электронов eU = 18 кэВ; плотность энергии пучка электронов  $E_S = 10 - 30$  Дж/см<sup>2</sup>; длительность т импульса 20, 50, 100, 200 мкс; количество N импульсов от 3 до 30, частота f следования импульсов 0,3 Гц.

Исследования фазового состава поверхностных сплавов проводили методами рентгеноструктурно-

го анализа (поверхность облучения, дифрактометр XRD 6000). Структуру поверхности облучения анализировали методами сканирующей электронной микроскопии (прибор SEM-515 «Philips»). Элементный состав поверхностного слоя материала определяли методами микрорентгеноспектрального анализа, используя микроанализатор EDAX ECON IV, являющийся приставкой к электронному сканирующему микроскопу SEM-515 «Philips».

Твердость поверхностного слоя системы пленка/ подложка на различных этапах электронно-ионноплазменного воздействия определяли при нормальных нагрузках на индентор 100, 200 и 500 мН (микротвердомер ПМТ-3) и при нагрузке на индентор, изменяющейся в пределах от 5 до 300 мН (прибор Nano Hardness Tester NHT-S-AX-000X). Исследования коэффициента трения и скорости износа поверхностного слоя проводили в геометрии диск – штифт с помощью трибометра (CSEM, Швейцария) при комнатных температуре и влажности. В качестве контр-тела использовали шарик из сплава ВК8 диам. 3 мм, диаметр трека составлял 4-6 мм, скорость вращения 2,5 см/с, нагрузка 1-5 H, дистанция до остановки 50 - 100 м, количество оборотов 3000-8000. Объем износа поверхностного слоя определяли после проведения профилометрии образовавшегося трека с помощью лазерного оптического профилометра MicroMeasure 3D Station (Stil, Франция). Скорость износа рассчитывали по формуле

$$V = \frac{2\pi RA}{FL} \,\mathrm{MM}^3/(\mathrm{H}\cdot\mathrm{M}),$$

где *R* – радиус трека, мм; *A* – площадь поперечного сечения канавки износа, мм<sup>2</sup>; *F* – величина приложенной нагрузки, H; *L* – пройденная шариком дистанция, м.

Анализ литературных источников, посвященных исследованию фазовых превращений в системе Al-Ti-Cu, позволил выявить следующие основные закономерности. Диаграмма состояния системы Cu-Ti является сложной и до настоящего времени обсуждаемой. Воспользуемся диаграммой состояния, представленной в работе [3]. В системе Cu-Ti (рис. 1) обнаружено существование шести соединений, два из которых плавятся конгруэнтно: γ-CuTi<sub>2</sub> (прототип MoSi<sub>2</sub>, символ Пирсона tl6, пространственная группа (пр. гр.) *I4/mmm*) при температуре 1010 °C, δ-CuTi (CuTi, *tP*4, *Р4птт*) при 984 °С. Четыре других соединения: β-Си<sub>4</sub> Ti (ZrAu<sub>4</sub>, *oP*20, *Pnna*), α-Cu<sub>4</sub>Ti (MoNi<sub>4</sub>, <u>*tI*10</u>, *I*4/*m*), λ-Cu<sub>2</sub>Ti (VAu<sub>2</sub>, oC12, Amm2), O-Cu<sub>3</sub>Ti<sub>2</sub> (Cu<sub>3</sub>Ti<sub>2</sub>, <u>tP10</u>, P4/mmn) и ε-Cu<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub> (Cu<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>, tI4, 14/mmm) – образуются по перитектическим реакциям [3]. Соединения λ и Θ существуют в узких температурных интервалах и распадаются по эвтектоидным реакциям. Соединения ζ, ε, δ и γ имеют узкие области гомогенности по составу. Кроме того, в ряде работ обнаружено существование соединения Си<sub>7</sub>Ті<sub>3</sub>, которое плавится конгрузнтно при температуре



Рис. 1. Бинарные диаграммы систем Al-Cu, Cu-Ti, Al-Ti [3] и изотермическое сечение тройной системы Al-Cu-Ti при 800 °C [4, 6]. Серым и темным цветом выделены однофазные области

905 °C, а при температуре 865 °C распадается по эвтектоидной реакции на Cu<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub> и Cu<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>.

Алюминий с медью (система Al–Cu) образуют диаграмму эвтектического типа со стороны алюминия (рис. 1). В системе Al–Cu выявлено 15 фаз. Две фазы (Cu) и (Al) являются твердыми растворами на основе меди и алюминия, шесть фаз: β-фаза (твердый раствор на основе соединения Cu<sub>3</sub>Al),  $\chi$ ,  $\gamma_1$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\eta_1$ -CuAl (символ Пирсона *oP*16, пр. гр. *Pban*) и θ-CuAl<sub>2</sub> (CuAl<sub>2</sub>, *t*12, 14/*mcm*) образуются с участием жидкой фазы, остальные фазы –  $\gamma_2$ -Cu<sub>9</sub>Al<sub>4</sub> (*cP*52, *P*43*m*),  $\alpha_2$  (прототип Al<sub>3</sub>Ti, *t*112, *I*4/*mmm*),  $\varepsilon_2$ -Cu<sub>1</sub> + <sub>*x*</sub>Al (AsNi, *hP*4, *P*63/*mmc*),  $\delta_1$ -Cu<sub>100</sub> – <sub>*x*</sub>Al<sub>*x*</sub>(38,1 ≤ *x* ≤ 40,7)(*R*3*m*),  $\zeta_1$  (*hP*4, *P*63/*mmm*),  $\zeta_2$ -Cu<sub>11,5</sub>Al<sub>9</sub> (*oI*24 – 3,5, *Imm*2),  $\eta_2$ -Al<sub>10</sub>Cu<sub>10</sub> (*mC*20, *C*2/*m*) образуются в результате превращений в твердом состоянии [3].

В системе Al–Ті при термодинамически равновесных условиях обнаружен ряд интерметаллических соединений (рис. 1): Ti<sub>3</sub>Al (прототип Ni<sub>3</sub>Sn, *hP8*, *P63/mmc*); TiAl (AuCu, <u>*tP2*</u>, *P4/mmm*); TiAl<sub>2</sub> (HfGa<sub>2</sub>, <u>*tI24*</u>, *I4*<sub>1</sub>/*amd*); TiAl<sub>3</sub> (TiAl<sub>3</sub>, <u>*tI8*</u>, *P4/mmm*); Ti<sub>9</sub>Al<sub>23</sub> обладает тетрагональной структурой [3].

Тройная система Al-Cu-Ti характеризуется рядом особенностей (рис. 1). Во-первых, в этой системе все сплавообразующие элементы являются металлами с сильно различающейся электронной структурой (табл. 1). Размеры атомов двух элементов Al и Ti близки, а радиус третьего атома Cu значительно меньше (табл. 1). Во-вторых, области гомогенности фаз, примыкающих к сторонам изотермического треугольника при

### Таблица 1

Металл	Электронная структура	<i>R</i> , нм	Символ Пирсона	Пр. гр.	Тип структуры в Strukturbericht	
Al	$[Ne]3s^23p^1$	0,1430	<u>cF4</u>	Fm3m	<u>A1</u>	
Ti	[Ar] $3d^24s^2$	0,1462	<u>hP2</u>	<u>P6<sub>3</sub>/mmc</u>	<u>A3</u>	
Cu	[Ar] $3d^{10}4s^1$	0,1280	<u>cF4</u>	Fm3m	<u>A1</u>	

Электронное строение и структура сплавообразующих элементов системы Al-Ti-Cu [3]

Таблица 2

Структурные характеристики фаз, формирующихся в тройных системах Al–Ti–Cu										
Фаза	Состав	Символ Пирсона	Пр. гр.	Тип структуры	Прототип	Источник				
$\tau_1$	TiCu <sub>2</sub> Al	<i>cF</i> 16	Fm3m	L2 <sub>1</sub>	MnCu <sub>2</sub> Al	[4]				
$\tau_2$	TiCuAl	hP12	P6 <sub>3</sub> /mmc	C14	MgZn <sub>2</sub>	[5]				
τ <sub>3</sub>	Ti <sub>2</sub> CuAl <sub>5</sub>	cP4	$Pm\overline{3}m$	L1 <sub>2</sub>	Cu <sub>3</sub> Au	[5]				
_	Ti <sub>25</sub> Cu <sub>4</sub> Al <sub>71</sub>	<i>tI</i> 16	I4/mmm	<u>D0</u> 22	ZrAl <sub>2</sub>	[4]				

температуре 800 °С небольшие, тогда как области гомогенности тройных соединений во внутренних областях фазовой диаграммы значительны (рис. 1). В-третьих, тройные соединения во внутренних областях фазовой диаграммы обладают плотноупакованными структурами с широким спектром сингоний: кубической, тетрагональной и гексагональной (табл. 2).

Не определен

٤

Таким образом, в термодинамически равновесных условиях в системе Al-Cu-Ti формируется большое число двойных и тройных фаз. Высокоскоростной метод термической обработки существенным образом ограничивает процесс фазообразования вследствие высоких скоростей отвода тепла в интегрально холодный объем подложки.

В качестве обобщающего параметра, характеризующего режим облучения материала импульсным электронным пучком и уровень сплавообразования, используем характеристику вида  $W_{S} = (E_{S}N/\tau)$ , учитывающую как плотность мощности пучка электронов, так и фоновый нагрев образца при многоимпульсной обработке. Экспериментальным путем установили, что система пленка (TiCu)/подложка (Al) не плавится при  $W_{\rm s} \le 0.5 \cdot 10^6 \, ({\rm Bt/cm^2})$ ·имп. В этом случае покрытие сохраняется, фиксируется множественное трещинообразование, делящее покрытие на фрагменты. Материалом, разделяющий фрагменты покрытия, является, как показал микрорентгеноспектральный анализ, алюминий. В интервале значений (1-6)·10<sup>6</sup> (Вт/см<sup>2</sup>)·имп. наблюдается формирование структуры островкового типа (островки покрытия разделены участками ячеистой кристаллизации системы пленка/подложка) (рис. 2, а, б). При значениях параметра  $W_s = 15 \cdot 10^6 ({\rm Br/cm^2}) \cdot {\rm имп.}$  система пленка (TiCu)/подложка (A7) устойчиво плавится (рис. 2, *e*, *e*). На поверхности формируется поликристаллическая структура, размер зерен которой изменяется в пределах от 5 до 40 мкм (рис. 2, *e*). В объеме зерен выявляется структура ячеистой кристаллизации с размером ячеек от 0,4 до 2,0 мкм (рис. 2, *e*, вставка).

Ti<sub>2</sub>Al<sub>5</sub>

[4]

Методами микрорентгеноспектрального анализа выявлено формирование поверхностных сплавов состава Al–Ti–Cu, концентрация элементов в которых существенным образом зависит от параметров облучения. Анализируя результаты, представленные на рис. 3, можно отметить, что концентрация легирующих элементов в поверхностном слое алюминия в зависимости от энергетики пучка электронов может изменяться в весьма широких (от 52 до 2,5 %) пределах. Таким образом, облучая систему пленка/подложка электронным пучком, можно в широких пределах варьировать элементный и, соответственно, фазовый составы поверхностного слоя материала.

Фазовый состав поверхностного слоя системы пленка (TiCu)/подложка (A7) анализировали методами дифракции рентгеновских лучей в геометрии Брегга-Брентано. Выполненные исследования позволили выявить формирование в поверхностном слое толщиной примерно 10 мкм многофазной структуры, качественный и количественный состав которой зависит от режима электронно-пучковой обработки. Установлено, что суммарная объемная доля вторых фаз (Al<sub>3</sub>Ti, Ti<sub>3</sub>Al, Ti<sub>3</sub>Cu) максимальна (примерно 40 %) при облучении системы по режиму:  $E_s = 15 \text{ Дж/см}^2$ ,  $\tau = 100 \text{ мкс}$ , N = 20 имп., f = 0,3 Гц, т.е. в поверхностном сплаве состава 79 % Al – 16 % Ti – 5 % Cu (рис. 3).



Рис. 2. Структура поверхности облучения системы пленка (TiCu)/подложка (технически чистый алюминий А7); параметры пучка электронов:

 $a, \delta - E_s = 15 \text{ Дж/см}^2, \tau = 50 \text{ мкс}, N = 3 \text{ имп.; } a, c - E_s = 15 \text{ Дж/см}^2, \tau = 20 \text{ мкс}, N = 20 \text{ имп. Сканирующая электронная микроскопия}$ 

Модификация фазового и элементного составов, дефектной субструктуры поверхностного слоя алюминия должна сказаться на физико-механических и трибологических свойствах материала. Для аттестации свойств поверхностного сплава были выполнены исследования твердости, модуля Юнга и износостойкости системы покрытие/подложка до и после электроннопучкового воздействия. Результаты анализа твердости поверхностного слоя приведены на рис. 4, *а*, модуля Юнга – на рис. 4, *б*. Отчетливо видно, что максимальная твердость 5 – 6 ГПа и максимальный модуль Юнга 200 – 250 ГПа достигаются на поверхности облучения. Учитывая, что модуль Юнга оксида  $Al_2O_3$  изменяется в пределах 200 – 400 ГПа, а модуль Юнга алюминия не



Рис. 3. Зависимость концентрации элементов поверхностного слоя системы пленка (TiCu)/подложка (А7) от параметров облучения импульсным электронным пучком:

□ - концентрация алюминия; О - титана; △ - меди



Рис. 4. Зависимость от нагрузки *F* на индентор твердости HV (*a*) и модуля Юнга *E* (*б*) поверхностных сплавов, сформированных при облучении импульсным электронным пучком системы пленка (TiCu)/подложка (A7); *E<sub>s</sub>* = 15 Дж/см<sup>2</sup>; *f* = 0,3 Гц; длительность τ импульсов, мкс, и их количество *N* указаны на рисунках

превышает 70 ГПа, можно сказать, что на стадии остывания на поверхности образцов формировалась тонкая пленка оксидной фазы. В интервале нагрузок на индентор 20 – 70 мН выявляется некоторый подслой, твердость которого примероно 2 ГПа (почти в 7 раз выше твердости исходного материала), модуль Юнга примерно 110 ГПа (почти в 1,8 раз выше модуля Юнга исходного материала).

При дальнейшем увеличении нагрузки на индентор твердость и модуль Юнга снижаются, приближаясь к характеристикам исходного материала. Следует однако отметить, что при облучении системы пленка/подложка электронным пучком с параметрами  $E_s = 15 \text{ Дж/см}^2$ ,  $f = 0,3 \Gamma \mu$ ,  $\tau = 50$  мкс, N = 20 имп. удается сформировать протяженный слой, твердость которого более чем в 3 раза, а модуль Юнга в 1,5 раза превышают значения для исходного алюминия. Увеличение прочностных свойств поверхностного слоя сопровождается повышением износостойкости примерно в 1,2 раза, что фиксируется в системе пленка/подложка, облученной электронным пучком с параметрами  $E_s = 15 \text{ Дж/см}^2$ ,  $f = 0,3 \Gamma \mu$ ,  $\tau = 100$  мкс, N = 20 имп.

**Выводы.** Осуществлен синтез высокоинтенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекунд-

ной длительности легких поверхностных сплавов на основе алюминия, обладающих высокими значениями твердости, модуля Юнга и износостойкости. Выполнены структурные исследования и показано, что повышение физико-механических характеристик алюминия обусловлено формированием в результате плавления и высокоскоростной кристаллизации системы пленка (TiCu)/подложка (алюминий) многофазного субмикронаноструктурного состояния.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. In Materials surface processing by directed energy techniques. Elsevier, 2006. P. 205 – 240.
- Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. // Изв. вуз. Физика. 2008. № 5. С. 60 – 76.
- Диаграммы состояния двойных металлических систем / Под ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1996 – 2000. Т. 1 – 3.
- 4. Raman A., Schubert K. // Z. Metallkd. 1965. Vol. 56. P. 99 104.
- Krypyakevich P.I., Markiv V.Y., Troyan A.A. // Dop. Akad. Nauk Ukr. RSR, A, Fiz.-Mat. Tekh. Nauki. 1964. № 7. P. 922 – 924.
- 6. Murray J.L. // Int. Met. Rev. 1985. Vol. 30. P. 211 233.

© 2014 г. Иванов Ю.Ф., Крысина О.В., Петрикова Е.А., Тересов А.Д., Клопотов А.А. Поступила 14 января 2014 г.

IZVESTIYA VUZOV. CHERNAYA METALLURGIYA = IZVESTIYA - FERROUS METALLURGY. 2014. NO. 8. VOL. 57, pp. 37-41.

# SYNTHESIS OF THE SURFACE ALLOYS BY HIGH - INTENSITY PULSED ELECTRON BEAM TREATMENT OF THE FILM/SUBSTRATE SYSTEM: STRUCTURE AND PROPERTIES

Ivanov Yu.F.<sup>1,2</sup>, Dr. Sci. (Eng.), Assist Professor (yufi55@mail.ru) Krysina O.V.<sup>1</sup>, Junior Researcher Petrikova E.A.<sup>1</sup>, Postgraduate Teresov A.D.<sup>1</sup>, Reading electronic Klopotov A.A.<sup>3</sup>, Dr. Sci. (Eng.), Professor

<sup>1</sup> Institute of High Current Electronics SB RAS (2/3, Akademicheskii pr., Tomsk, 634055, Russia)

<sup>2</sup> National Research Tomsk Polytechnic University (30, pr. Lenina, Tomsk, 634050, Russia)

<sup>3</sup> Tomsk State University of Architecture and Building (2, Solyanaya sqr., Tomsk, 634003, Russia)

*Abstract.* Nano-structured multiphase surface light alloys of Al–Ti–Cu system have been synthesized by pulsed melting of the high-intensity electron beam of the film / substrate. Irradiation modes allowing multiply increase strength and tribological characteristics of the initial material have been identified.

*Keywords*: film/substrate, electron beam, surface alloys, phase composition, structure, properties.

#### REFERENCES

- Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. In *Materials surface processing by directed energy techniques*. Elsevier, 2006, pp. 205–240.
- Koval' N.N., Ivanov Yu.F. Nanostructuring of surfaces of metalloceramic and ceramic materials by electron-beams. *Russian Physics Journal*. 2008, Vol. 51, no. 5, pp. 505–516.
- **3.** Diagrammy sostoyaniya dvojnyh metallicheskih sistem [Diagrams of binary metal systems]. Lyakishev N.P. ed. Moscow: Mashinostroenie, 1996–2000. Vol. 1–3. (In Russ.)
- 4. Raman A., Schubert K. Z. Metallkd. 1965. Vol. 56, pp. 99–104.
- Krypyakevich P.I., Markiv V.Y., Troyan A.A. Dop. Akad. Nauk Ukr. RSR, A, Fiz.-Mat. Tekh. Nauki. 1964, no. 7, pp. 922–924.
- 6. Murray J.L. Int. Met. Rev. 1985. Vol. 30, pp. 211–233.
- *Acknowledgements*. This work was partially financially supported by the grant of RFBR (project no.13-08-00416 and no.13-08-98084).

Received January 14, 2014